【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第４区分
【発行日】平成18年9月7日(2006.9.7)

【公開番号】特開2001-40481(P2001-40481A)
【公開日】平成13年2月13日(2001.2.13)
【出願番号】特願平11-211849
【国際特許分類】
Ｃ２３Ｃ　16/455　(2006.01)
Ｂ０１Ｊ　4/00　(2006.01)
Ｆ１７Ｄ　1/02　(2006.01)
Ｈ０１Ｌ　21/285　(2006.01)
【ＦＩ】
Ｃ２３Ｃ　16/455
Ｂ０１Ｊ　4/00　１０２
Ｆ１７Ｄ　1/02
Ｈ０１Ｌ　21/285　Ｃ

【手続補正書】
【提出日】平成18年7月20日(2006.7.20)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】特許請求の範囲
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】　処理ガスを供給する処理ガスラインと、この処理ガスラインと合流するとともに処理ガスをキャリアするキャリアガスを供給するキャリアガスラインと、被処理基板が配置され、キャリアガスによってキャリアされた処理ガスが導入されるチャンバーとを具備し、チャンバー内で被処理基板に所定のガス処理を施すガス処理装置であって、
前記キャリアガスラインと前記処理ガスラインとの合流部分において、キャリアガスラインと合流部下流側部分とが直線状をなし、処理ガスラインと合流部下流側部分とが屈曲していることを特徴とするガス処理装置。
【請求項２】　前記キャリアガスラインにおけるキャリアガスの流量が１００ｓｃｃｍ以上であることを特徴とする請求項１に記載のガス処理装置。
【請求項３】　前記被処理基板上に形成される膜の膜厚が１００ｎｍ以下であることを特徴とする請求項１または請求項２に記載のガス処理装置。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００９】
この場合に、前記キャリアガスラインにおけるキャリアガスの流量が１００ｓｃｃｍ以上であることが好ましい。これにより、キャリアガスの流量に依存せず残存処理ガス濃度を略一定にすることが可能となる。また、前記被処理基板上に形成される膜の膜厚が１００ｎｍ以下であることが好ましい。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】００１５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１５】
また、チャンバー１１の底部の四隅には、排気口３６が設けられており、この排気口３６には、図示しない真空ポンプが接続されている。これにより、チャンバー１１内は、例えば１００Ｔｏｒｒ～10^{-6} Ｔｏｒｒの真空度に維持し得るようになっている。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２２】
所定時間経過後、ガスライン５５のバルブ６１が閉じられ、第１のWF_6ガス供給源５１からのニュークリエーション用のWF_6ガスの供給が停止され、代わりに第２のWF_6ガス供給源５３に接続された第２の処理ガスライン５７のバルブ６７が開かれメインのWF_6ガスが第２の処理ガスライン５７からキャリアガスライン５６に合流する。